

日本真空学会関西支部 第10回実用技術セミナー

## —新しい成膜・膜構造制御技術と応用例—

主催 日本真空学会関西支部

協賛 エレクトロニクス実装学会関西支部、応用物理学会関西支部、大阪科学技術センター、大阪府技術協会、化学工学会、化学工学会エレクトロニクス部会、近畿高エネルギー加工技術研究所、高分子学会、自動車技術会、新無機膜研究会、精密工学会関西支部、センシング技術応用研究会、電気化学会、電気学会、電子情報通信学会、日本機械学会関西支部、日本材料科学会、日本材料学会関西支部、日本真空工業会、日本電機工業会、日本表面科学会、日本物理学会、日本包装コンサルタント協会関西支部、ニューセラミックス懇話会、表面技術協会（依頼中）

真空蒸着やスパッタリング法などの物理蒸着法や熱やプラズマ等を用いた化学蒸着法は、我々の生活を支えるための基盤技術として必要不可欠なものとなっています。最近では、地球温暖化抑制のため、様々な機器やデバイスのさらなる省エネルギー化や小型・軽量化が進められています。成膜技術においても、これらの実現に向けた新しい手法や膜構造制御技法が、開発され、実用化が図られています。本セミナーでは、これらの研究・開発・製造に携わっておられる第一線の研究者・技術者の方々に講演していただきます。

日時：2018年1月26日(金曜日) 13:00～17:00

場所：株式会社島津製作所関西支社マルチホール（大阪梅田 阪急ターミナルビル14階）

参加費：日本真空学会会員 2,000円、協賛学協会会員 3,000円、一般 5,000円、学生 1,000円（消費税込み）

定員：60名

### 講演プログラム

13:00～13:10 開催の挨拶

13:10～14:00 原子層堆積（ALD）技術とその応用

奈良先端科学技術大学 浦岡 行治

14:50～14:55 酸化ガリウム半導体とミストCVD成膜

株式会社 FLOSFIA(フロスフィア) 國枝 浩二

14:50～15:10 休憩

15:10～16:00 高分子ナノ相分離を利用した分子輸送チャンネルデバイスの開発

同志社大学 彌田 智一

16:00～16:50 電気と熱を同時制御可能とするナノ構造技術の開発

大阪大学 中村 芳明

16:50～17:00 閉会の挨拶

日本真空学会関西支部長 桑原裕司

申し込み締め切り：2018年1月22日(金曜日)

申し込み方法：ホームページからお申し込みください。

<http://www.vacuum-jp.org/event/20180126>

### 問い合わせ先

一般財団法人日本真空学会関西支部 実用技術セミナー担当 澤田 泰幸（神港精機株式会社）

電話：(03) 3271-2156

E-mail: [y-sawada@shinko-seiki.com](mailto:y-sawada@shinko-seiki.com)

会場の案内：株式会社島津製作所 関西支社 マルチホール

〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階

TEL(06)6373-6522 FAX(06)6373-6524

<http://www.shimadzu.co.jp/aboutus/company/access/kansai.html>